PCT

REQUEST

For receiving	g Office use only
International Application No.	
International Filing Date	10/088656
Name of receiving Office and "	PCT International Application"

The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty. Applicant's or agent's file reference (if desired) (12 characters maximum) G-18 (KYOKA) Box No. I TITLE OF INVENTION DOPE FOR POLYURETHANE OR AROMATIC POLYAMIDE ARTICLE, AND USE OF HYDROTALCITE COMPOUND PARTICLES THEREIN APPLICANT Box No. II Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is also inventor. Telephone No. KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. Facsimile No. 305, Yashimanishimachi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken 761-0113 JAPAN Teleprinter No. State (that is, country) of nationality: State (that is, country) of residence: **JAPAN** JAPAN the United States of America only the States indicated in the Supplemental Box all designated States all designated States except the United States of America This person is applicant for the purposes of: FURTHER APPLICANT(S) AND/OR (FURTHER) INVENTOR(S) Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country. The country of the address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence if no State of residence is indicated below.) This person is: applicant only OKADA Akira c/o KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., applicant and inventor RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPARTMENT, inventor only (If this check-box 4285, Hayashida-cho, Sakaide-shi, Kagawa-ken 762-0012 is marked, do not fill in below.) **JAPAN** State (that is, country) of residence: State (that is, country) of nationality: **JAPAN JAPAN** the States indicated in the Supplemental Box W the United States of America only all designated States all designated States except the United States of America This person is applicant for the purposes of: V Further applicants and/or (further) inventors are indicated on a continuation sheet. AGENT OR COMMON REPRESENTATIVE; OR ADDRESS FOR CORRESPONDENCE The person identified below is hereby/has been appointed to act on behalf common representative agent of the applicant(s) before the competent International Authorities as: Name and address: (Family name followed by given name; for a legal entity, full official designation. The address must include postal code and name of country.) Telephone No. 03-3356-7565 OHSHIMA Masataka Facsimile No. 03-3356-8826 OHSHIMA PATENT OFFICE, Fukuya Bldg., 3, Yotsuya 4-chome, Shinjuku-ku, Teleprinter No. TOKYO 160-0004 JAPAN Address for correspondence: Mark this check-box where no agent or common representative is/has been appointed and the space above is used instead to indicate a special address to which correspondence should be sent.

Form PCT/RO/101 (first sheet) (July 1998; reprint January 2000)

See Notes to the request form

Continuation of Box No. III FURTHER APPLICANT(S) A	nd/or (further) inventor(s)			
If none of the following sub-boxes is used, this sheet should not be included in the request.				
Name and address: (Family name followed by given name; for a leasignation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.) SHIMIZU Koji c/o KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO RESEARCH AND DEVELOPMENT DEPA 4285, Hayashida-cho, Sakaide-shi, Kagawa-IJAPAN	of residence if no State This person is: applicant only IV applicant and inventor RTMENT,			
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:			
JAPAN	JAPAN			
This person is applicant all designated all designated for the purposes of:	States except the United States the States indicated in the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a li designation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	regal entity, full official tory. The country of the of residence if no State This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:			
This person is applicant all designated all designated for the purposes of: States all designated the United Sta	States except the United States the States indicated in the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a l designation. The address must include postal code and name of cour address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country) of residence is indicated below.)	egal entity, full official thry. The country of the of residence if no State This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:			
	I States except ates of America only the States indicated in the Supplemental Box			
Name and address: (Family name followed by given name; for a designation. The address must include postal code and name of cou address indicated in this Box is the applicant's State (that is, country of residence is indicated below.)	legal entity, full official note. The country of the of fresidence if no State This person is: applicant only applicant and inventor inventor only (If this check-box is marked, do not fill in below.)			
State (that is, country) of nationality:	State (that is, country) of residence:			
	d States except the United States the States indicated in tates of America only the Supplemental Box			

3

Box No.	Box No.V DESIGNATION OF STATES				
The following designations are hereby made under Rule 4.9(a) (mark the applicable check-boxes; at least one must be marked):					
Regional Patent					
AP ARIPO Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenya, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swaziland, TZ United Republic of Tanzania, UG Uganda, ZW Zimbabwe, and any other State which is a Contracting State of the Harare Protocol and of the PCT					
□ EA	Eurasian Patent: AM Armenia, AZ Azerbaijan, BY E			G Kyrgyzstan, KZ Kazakhstan, MD Republic of Moldova, ther State which is a Contracting State of the Eurasian Patent	
	European Patent: AT Austria, BE Belgium, CH a DK Denmark, ES Spain, FI Finland, FR France, GB U MC Monaco, NL Netherlands, PT Portugal, SE Sweden, Convention and of the PCT	Inite and	d King any ot	vitzerland and Liechtenstein, CY Cyprus, DE Germany, gdom, GR Greece, IE Ireland, IT Italy, LU Luxembourg, ther State which is a Contracting State of the European Patent	
□ OA	GA Gabon, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali,	MR acting	Mauri State	Republic, CG Congo, CI Côte d'Ivoire, CM Cameroon, itania, NE Niger, SN Senegal, TD Chad, TG Togo, and any of the PCT (if other kind of protection or treatment desired,	
Nation	al Patent (if other kind of protection or treatment desired, spe	cify o	n dotte	ed line):	
	United Arab Emirates	_		Liberia	
DAL	Albania	_		Lesotho	
	Armenia			Lithuania	
	Austria			Luxembourg	
	Australia			Latvia	
	Azerbaijan	H		Morocco	
=	Bosnia and Herzegovina				
	Barbados			Republic of Moldova	
	Bulgaria	H		Madagascar	
	Brazil		IVIE	The former Yugoslav Republic of Macedonia	
	Belarus		N.FNI	Manualta	
	Canada			Mongolia	
=	and LI Switzerland and Liechtenstein			Malawi	
=		밁		Mexico	
	China Costa Rica	_		Norway	
	Cuba			New Zealand	
=	Czech Republic		PL	Poland	
_	Germany	_	PT	Portugal	
	Denmark	_	RO	Romania	
1 =	I Dominica		RU	Russian Federation	
	Estonia			Sudan	
ES			SE	Sweden	
	•		SG	Singapore	
1 = -		=	SI	Slovenia	
	United Kingdom	_	SK	Slovakia	
	Grenada			Sierra Leone	
	Georgia	느		Tajikistan	
	Ghana			Turkmenistan	
	1 Gambia	_	TR	Turkey	
	Croatia		_	Trinidad and Tobago	
1	Hungary	با		United Republic of Tanzania	
	Indonesia	Ļ		Ukraine	
	Israel	<u></u>	2	Uganda	
	India	¥	US	United States of America	
☐ IS	Iceland	_			
☐ Jb	Japan] UZ		
	Kenya	Ę] VN	Viet Nam	
□ K	G Kyrgyzstan] YU	5	
	P Democratic People's Republic of Korea] ZA	South Africa	
				Zimbabwe	
図 ko	R Republic of Korea	Ç	heck-	boxes reserved for designating States which have party to the PCT after issuance of this sheet:	
	Z Kazakhstan	b	_		
DL	Saint Lucia]		
	Sri Lanka		3		
		matic	ons ma	ide above, the applicant also makes under Rule 4.9(b) all other	
design	ations which would be permitted under the PCT except a	ny d	esigna	tion(s) indicated in the Supplemental Box as being excluded	
from 1	he scope of this statement. The applicant declares that	thos	addi:	tional designations are subject to confirmation and that any	
designation which is not confirmed before the expiration of 15 months from the priority date is to be regarded as withdrawn by the applicant at the expiration of that time limit. (Confirmation (including feed must reach the receiving Office within the 15-month time limit.)					

Box No. VI PRIORITY CLAIM Further priority claims are indicated in the Supplemental Box.						
Filing date Number Where earlier application is:						
of earlier application of earlier application national application: regional application: international application: regional Office receiving Office						
item (1) Patent Application						
24.07.00	No.2000-221762	Japan				
item (2)						
item (3)						
of the earlier application	quested to prepare and trans (s) (only if the earlier appli aternational application is the	cation was filed with the	Office which for the	(1)		
• Where the earlier application is Convention for the Protection of i	r an ARIPO application, it is m Industrial Property for which th	andatory to indicate in the Si at earlier application was fil	upplemental Box at least one of (Rule 4.10(b)(ii)). See Supp	country party to the Paris elemental Box.		
Box No. VII INTERNATI	ONAL SEARCHING AUT	HORITY				
Choice of International Sear- (if two or more International Secondetent to carry out the inter the Authority chosen; the two-lette ISA/JP	earching Authorities are sea national search, indicate		riier search; reference to r requested from the Internatio Number C			
	T. LANGUAGE OF FULL	NC.				
Box No. VIII CHECK LIST; LANGUAGE OF FILING This international application contains This international application is accompanied by the item(s) marked below:						
the following number of she			med by the hem(s) market	i delow.		
request :	4 1 -					
description (excluding		signed power of attorney				
sequence listing part) :			reference number, if any:			
claims :	· —	it explaining lack of signal				
abstract :	1 5. priority	locument(s) identified in l	Box No. VI as item(s):			
drawings :	0 6. 🗖 translatio	on of international applica	tion into (language):			
sequence listing part of description :	0 1		posited microorganism or	•		
8. nucleotide and/or amino acid sequence listing in computer readable form Total number of sheets: 25 9. other (specify):						
Figure of the drawings which Language of filing of the						
should accompany the abstract: international application: Japanese						
Box No. IX SIGNATURE OF APPLICANT OR AGENT						
Next to each signature, indicate the name of the person signing and the capacity in which the person signs (if such capacity is not obvious from reading the request).						
OUGUTMA Mogactaira						
OHSHIMA Masataka						
For receiving Office use only						
Date of actual receipt of the purported international application: 2 Drawings:				2. Drawings:		
3. Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported international application:				received:		
Date of timely receipt of corrections under PCT A	uticle 11(2):			not received:		
5. International Searching A (if two or more are comp	Authority ISA JP	6. Transm	ittal of search copy delayed arch fee is paid.	1		
	For In	ternational Bureau use on	ly			
Date of receipt of the record	i copy					

To:

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

Date of mailing (day/month/year) 31 January 2002 (31.01.02)

Applicant's or agent's file reference

G-18 (KYOKA)
International application No.

PCT/JP01/06335

IMPORTANT NOTICE

From the INTERNATIONAL BUREAU

OHSHIMA, Masataka Ohshima Patent Office

3, Yotsuya 4-chome

Fukuya Building

Shinjuku-ku Tokyo 160-0004

JAPON

International filing date (day/month/year)
23 July 2001 (23.07.01)

Priority date (day/month/year) 24 July 2000 (24.07.00)

Applicant

KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:
KR.US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

CA,EP

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 31 January 2002 (31.01.02) under No. WO 02/08123

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the **national phase**, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and the PCT Applicant's Guide, Volume II.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.91.11

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年1 月31 日 (31.01.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/08123 A1

(51) 国際特許分類?: **C01F 7/00**, C08L 75/04, C08K 3/26, C08L 77/00, D01F 6/94, 6/90

CO., LTD.) [JP/JP]; 〒761-0113 香川県高松市屋島西町 305 Kagawa (JP).

[JP/JP]: 〒762-0012 香川県坂出市林田町4285 協和化学工業株式会社 研究開発部内 Kagawa (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/06335

(72) 発明者; および

(22) 国際出願日:

2001年7月23日(23.07.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(74) 代理人: 大島正孝(OHSHIMA, Masataka): 〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目3番地 福屋ビル 大島特許事 務所 Tokyo (JP).

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡田 彰 (OKADA, Akira) [JP/JP]. 清水晃治 (SHIMIZU, Koji)

(30) 優先権データ:

特願2000-221762 2000年7月24日(24.07.2000) JP

(81) 指定国 (国内): CA, KR, US.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 協和化 学工業株式会社 (KYOWA CHEMICAL INDUSTRY (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

「続葉有」

(54) Title: LIQUID RAW MATERIAL FOR PRODUCING FORMED POLYURETHANE OR AROMATIC POLYAMIDE AND USE OF HYDROTALCITE COMPOUND PARTICLES THEREFOR

(54) 発明の名称: ポリウレタンまたは芳香族ポリアミド成形用原液およびそのためのハイドロタルサイト化合物粒子の利用

(57) Abstract: A dispersion liquid which comprises an organic polar solvent and hydrotalcite compound particles having: (1) an average secondary particle diameter of 0.1 to 3?m as measured by the laser light diffraction scattering method, (2) a specific surface area of 0.5 to 10 m²/g as measured by the BET method, and (3) hydrotalcite compound particles having crystal grains of a plate form; and a liquid raw material for producing a formed polyurethane or aromatic polyamide which comprises the dispersion liquid. The hydrotalcite compound particles are excellent in the affinity to and the dispersibility in an organic polar solvent, and the liquid raw material for producing a formed polyurethane or aromatic polyamide contains the hydrotalcite compound particles being uniformly dispersed therein.

(57) 要約:

- (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が $0.1 \sim 3 \mu m$ であり、
- (2) BET法により測定した比表面積が0.5~10m²/gであり、かつ
- (3) 板状の結晶粒子形状を有するハイドロタルサイト化合物粒子と有機極性 溶媒よりなる分散液、およびポリウレタンまたは芳香族ポリアミド成形用原液。

有機極性溶媒に対し親和性および分散性の優れたハイドロタルサイト化合物粒子を提供し、この粒子が均一に分散配合されたポリウレタンまたは芳香族ポリアミド成形用原液を提供することができた。

O 02/08123 A1

1

明細書

ポリウレタンまたは芳香族ポリアミド成形用原液 およびそのためのハイドロタルサイト化合物粒子の利用

5

発明の詳細な説明

発明の属する技術分野

本発明は、耐塩素性および耐熱劣化性に優れたポリウレタンまたは芳香族ポリアミドより形成された成形品およびそのための成形用原液に関する。さらに詳しくは特定の形状のハイドロタルサイト化合物粒子を含有したポリウレタンまたは芳香族ポリアミドより形成された成形品およびそのための成形用原液に関する。また本発明は、前記成形用原液に配合されるハイドロタルサイト化合物粒子自体にも関する。

ハイドロタルサイト化合物粒子は、そのアニオン交換能による素速いハロゲン 15 捕捉剤として、または酸中和剤として、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル(PV C)、ポリオレフィンおよびポリアミド等の樹脂またはゴム(エラストマー)に 広く使用されている。

しかしながら、最近の社会的要求特性の増大とともに、樹脂に対する塩素、熱や 光等に対する優れた安定性が厳しく要求されるようになってきた。そのため樹脂 20 に添加する各種配合剤の耐塩素性、耐熱、耐光等の優れた安定性が必要となり、 安定剤としてのハイドロタルサイト化合物粒子は配合量が少ないにもかかわらず、 なお解決すべき問題があることが判明してきた。

例えば、ポリウレタン弾性繊維では、その高度のゴム弾性、優れた回復性を有しまた引張応力等の機械的物性にも優れているため機能性衣料に広く使用されている。また、洗濯時の塩素漂白や塩素殺菌処理したプール水により、物性の低下、変色等が起こることも知られている。この塩素による劣化を防ぐために耐塩素剤として酸化亜鉛を使用する方法(特開昭57-29609号公報、特願昭56-93119号公報)が主に用いられているが、酸化亜鉛は染色工程での酸性条件

下で溶出し易いという欠点がある。

この欠点を低減するため、ハイドロタルサイト化合物粒子を用いる方法が提案されている(特開昭59-133248号公報)。しかしながら、ハイドロタルサイト化合物粒子は耐塩素剤としての効果はあるが、ポリウレタンの重合および 紡糸に用いられるジメチルホルムアミド(DMF)、ジメチルアセトアミド(DMAC)、等の有機極性溶剤への親和性に乏しく、分散性が悪いため、多くの改善提案がなされている。

例えば特開平3-292364号公報では高級脂肪酸および/またはシランカップリング剤で表面処理された平均粒子径が1μm以下のハイドロタルサイト化10 合物粒子を、また特開平5-78569号公報では炭素数10~30の脂肪酸で表面処理されたハイドロタルサイト化合物粒子を用いることがそれぞれ提案されている。特開平10-168657号公報および特開平10-168662号公報では、ビーズミルによる粉砕(または磨砕)工程を経て微細化されたハイドロタルサイト化合物粒子および/または塩基性金属アルミニウムヒドロキシ化合物粒子をアニオン性界面活性剤、脂肪酸、シラン、ポリ有機シロキサン、ポリ有機水素シロキサン等の表面処理剤で被覆してまたは被覆しないで用いることが提案されている。

ポリウレタン繊維の耐塩素剤として高級脂肪酸で表面処理されたハイドロタルサイト化合物粒子が使用されているが、ポリウレタンの重合や紡糸に用いられるジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルフォキサイド等の有機極性溶剤は、ハイドロタルサイト化合物粒子との相容性に乏しく、使用に際しては該有機溶媒中で長時間湿式粉砕を実施して微粒子化および分散を計っている。それでもスクリーン・メッシュ通過性の問題は完全に解決されておらず、耐塩素劣化剤としてポリウレタン繊維のほんの一部のグレイドに使用されているにすぎない。

また湿式粉砕により、ハイドロタルサイト化合物粒子の結晶表面の一部は破壊され、結晶欠陥となりこれが新たな活性点となり、酸化防止剤等の他有機添加剤との相互作用により、発色の原因となったり、この結晶欠陥により溶解度が高く

なり染色後のタンニン液処理において変色が強くなったりすることもある。

さらに結晶欠陥同士が相補う形でハイドロタルサイト化合物粒子の凝集が進行 し、スクリーン・メッシュ通過性不良の問題を発生したり、また欠陥は付着水の 吸着サイトとなるため水分吸着による膨潤等の問題を引き起こすこともある。

また芳香族ポリアミドフィルムもしくは繊維は、その非常に優れた強度、剛性 により、産業用補強材、防弾チョッキ等に加工されているが、これらにもポリウ レタン同様、耐塩素性、耐熱劣化性が要求されている。

これらの問題を解決するため、研究を進めたところ、ハイドロタルサイト化合物粒子の形状、粒子径、比表面積が相互に分散性、耐熱劣化、耐塩素および物性10 等に影響を与えることが判明し、これらを特定の値とすることによって、優れた耐熱劣化性、耐塩素劣化性、加工性、耐変色、耐退色、環境負荷の軽減を有する高分散性安定剤となりうることがわかった。

発明が解決しようとする課題

本発明の主たる目的は湿式粉砕処理する必要がなく有機極性溶媒中でも容易に分散できるハイドロタルサイト化合物粒子を提供することであり、各種ポリマー等に安定剤として添加する際、まず有機極性溶剤に分散させた後、混合する方式を採る場合に特に好適であり、とりわけ、ポリウレタン繊維への塩素劣化防止剤として用いる場合、有機極性溶剤中への分散液の調製が容易であり、また、製造工程において着色、変色、メシュ詰まり等の問題を起こさないハイドロタルサイト化合物粒子を提供することにある。

さらに本発明の目的は、安定剤として樹脂、色素等に配合した場合、樹脂の物性低下、成形品および加工品の熱劣化、塩素劣化等をおこさない樹脂組成物およびその成形品、加工品等を提供することにある。

25

課題を解決するための手段

ハイドロタルサイト化合物粒子をポリウレタンの耐塩素剤として用いた場合に 発生する問題点の多くは、該化合物粒子がDMF、DMAC等の有機極性溶媒に 対する相溶性に乏しく分散性が悪いと言う点に源を発しており、これを補うため 長時間の湿式粉砕処理を行った結果さらに問題点が増大することになる。従って 湿式粉砕処理をしなくても通常の攪拌のみで容易に有機極性溶媒中に分散するハ イドロタルサイト化合物粒子、またはたとえ湿式粉砕しても結晶表面が何ら変化 しない堅固な結晶構造をもったハイドロタルサイト化合物粒子を、鋭意研究した 結果本発明到達した。

すなわち、ハイドロタルサイト化合物粒子が分散性に優れかつ耐塩素劣化等に 顕著な作用を発現するのは、その粒子径、比表面積および形状が影響しているこ と、従って樹脂に配合して高分散性で極めて塩素劣化の少ない組成物を得るため のハイドロタルサイト化合物粒子は、特定の条件を満足する形状でなければなら ないことが判明した。

本発明によれば、

- (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が0.60~3 μ mであり、
- 15 (2) BET法により測定した比表面積が0.5~10m²/gであり、かつ
 - (3) 結晶粒子形状が板状である

ハイドロタルサイト化合物粒子 および

(B) 有機極性溶媒

よりなる分散液が提供される。

- 20 また、本発明によれば、
 - (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が $0.60\sim3$ μ mであり、
 - (2) BET法により測定した比表面積が0.5~10m²/gであり、かつ
 - (3) 結晶粒子形状が板状である
- 25 ハイドロタルサイト化合物粒子
 - (B) 有機極性溶媒 および
 - (C) ポリウレタンまたは芳香族ポリアミド

よりなる乾式もしくは湿式成形用原液が提供される。

さらに本発明によれば、前記成形用原液を乾式もしくは湿式成形して得られたポリウレタン繊維、芳香族ポリアミド繊維もしくは芳香族ポリアミドフィルムが提供される。

以下、本発明についてさらに詳細に説明する。

本発明に使用されるハイドロタルサイト化合物粒子は、レーザ光回折散乱法による粒度分布測定より得られた平均二次粒子径(MV値)が $0.60\sim3\mu$ mで、好ましくは $0.8\sim2\mu$ mであり、より好ましくは $1.0\sim1.5\mu$ mである。平均粒子径が大きいほど有機極性溶媒中への分散性は良好となり、また粘度も低くなり使い易くなる。しかしながら、繊維やフィルム用途に使用するには平均粒子径は大きくとも 3μ mが望ましい。範囲下限の 0.6μ m未満では凝集し易くなり、有機極性溶媒中での粘度も高くなり、使い勝手が悪くなる。また必要に応じて湿式粉砕処理した場合、着色する傾向も大きくなる。

またBET法で測定した比表面積は $0.5\sim10\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ で、好ましくは $1\sim7\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ である。比表面積が小さいほど溶媒との接触面積が小さくなり、両者間 の相互作用が小さくなるため、分散性も良好となるものと考えられる。比表面積 が $10\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ を超えると凝集し易くなり、一方 $0.5\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ より小さくなる と化学的活性が低くなり過ぎるために耐塩素性質が劣化する。また、塩素劣化防止の点からは $1\sim7\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ 以上が望ましい。

結晶粒子形状としては分散液の粘度を低く保ち、メッシュ通過性が良く、湿式 20 粉砕時に壊れにくいものが望ましく、そのため板状を有するものが使用され、好ましくは平均アスペクト比(長径/厚み)が1.7~8、特に好ましくは2~6 の板状の結晶粒子形状を有するハイドロタルサイト化合物粒子が好ましい。

本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は一般化学式(I)で示され、

 $Mg_{1-x}Al_{x} (OH)_{2} (CO_{3})_{y} (A^{n-})_{z} \cdot mH_{2}O \dots (I)$

 $^{2-}$ 、 PO_3^{3-} 、 PO_2^{-} 、 $H_2BO_3^{-}$ 、 SiO_3^{2-} 、 $HSi_2O_5^{-}$ 、 $Si_2O_5^{2-}$ または有機酸イオンが好ましく挙げられる。

本発明における前記ハイドロタルサイト化合物粒子は前記(1)~(3)の条件を満足する限り、その調製法は特に制限を受けない。調製法としては、例えば 下記がある。

特公昭46-2280号公報、特公昭47-32198号公報、特公昭50-30039号公報、特公昭48-29477号公報、特公昭51-29129号公報、その他の方法で得られるハイドロタルサイト化合物粒子を、例えば、水性媒体中で加熱処理することにより得ることが出来る。

10 本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は、調製後、十分に水洗されていることが望ましい。また有機極性溶剤と相互作用しうる可能性のある、アルカリ金属およびアルカリ土類金属の塩酸塩、臭酸塩、硝酸塩、硫酸塩、炭酸塩、ホウ酸塩、重炭酸塩等の可溶性塩類の含量が十分に少ないことが望ましい。

さらに環境負荷が大きいとされているPb、Hg、CdまたはSnの各含有量 15 は金属として1ppm以下であることが有利である。

本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は、比表面積を低く、結晶粒子を大きくしたことで化学的活性が低くなり耐酸性に優れ、染料分子の吸着容量が小さくなり、また湿式粉砕処理にも耐えられる安定な結晶粒子であり、有機極性溶媒に対して極めて分散性に優れている。

- 20 そのため、本発明のハイドロタルサイト化合物粒子はポリウレタンや芳香族ポリアミドのような有機極性溶媒を使用する乾式または湿式成形に有利に利用できる。すなわち、ポリウレタンや芳香族ポリアミドを有機極性溶媒に溶解した成形用の原液中に、本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は極めてよく分散し、しかも安定した分散状態を維持できる。
- 25 本発明によれば、ハイドロタルサイト化合物粒子が良好に分散した有機極性溶媒分散液を調製することができ、さらにこの分散液を添加したポリウレタンまたは芳香族ポリアミドを溶解した成形用原液から安定した条件でフィルムや繊維を得ることができる。かくして、ハイドロタルサイト化合物粒子がポリマー中に均

質に分散したポリウレタン繊維、芳香族ポリアミドの繊維またはフィルムを得る ことができる。

本発明において有機極性溶媒としては、ポリウレタンや芳香族ポリアミドの溶液の調製のために通常使用されているものが使用され、例えばジメチルホルムア 5 ミド (DMF)、ジメチルアセトアミド (DMAC)、ジメチルスルフォキサイド (DMSO) およびNーメチルピロリドン (NMP) が好ましく挙げられる。

有機極性溶媒中にハイドロタルサイト化合物粒子を分散させた分散液中のハイドロタルサイト化合物粒子の含有量は10~30重量%、好ましくは15~25 重量%が望ましい。

10 本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は、それ自体有機極性溶媒に対して優れた親和性と分散性を有しているが、表面処理剤で表面処理することにより、一層その効果が増大するばかりでなく、ポリウレタンまたは芳香族ポリアミドの成形品中における耐塩素剤としての効果も優れたものとなる。

ハイドロタルサイト化合物粒子の表面処理剤としては、高級脂肪酸類;オルトリン酸とステアリルアルコールとのモノまたはジエステルであってそれらの酸またはアルカリ金属塩等のリン酸部分エステル類;シランカップリング剤(一般式:Y-Si(OR)3、Yはアルキル基,ビニル基、アリル基、アミノ基、メタクリル基、メルカプト基、ORはアルコキシ基を表す);イソプロピルトリイソステアロイルチタネート、イソプロピルトリス(ジオクチルパイロフォスフェート)チタネート、イソプロピルトリ (N-アミノエチル-アミノエチル)チタネート、イソプロピルトリデシルベンゼンスルホニルチタネート等のチタネート系カップリング剤類;アセトアルコキシアルミニウムジイソプロピレート等のアルミニウム系カップリング剤類が例示できる。

これらのうち、高級脂肪酸類、アニオン系界面活性剤、リン酸エステル類およ びカップリング剤よりなる群から選ばれる少なくとも1種の表面処理剤が好適で ある。

前記した表面処理剤を使用して、ハイドロタルサイト化合物粒子の表面コーティング処理をするには、それ自体公知の湿式または乾式により実施できる。例え

ば、湿式法としては、ハイドロタルサイト化合物粒子のスラリーに該表面処理剤を液状またはエマルジョン状で加え、約100℃までの温度で機械的に十分混合すればよい。乾式法としては、ハイドロタルサイト化合物粒子をヘンシェルミキサー等の混合機により、十分攪拌下で表面処理剤を液状、エマルジョン状、固形 状で加え、加熱または非加熱下に十分混合すればよい。

表面処理をしたハイドロタルサイト化合物粒子は、必要により、例えば水洗、脱水、造粒、乾燥、粉砕または分級等の手段を適宜選択して実施し、最終製品形態とすることが出来る。表面処理剤の添加量はハイドロタルサイト化合物粒子100重量部当り、10量部以下、好ましくは、0.1~5重量部以下であるのが2ましい。

本発明ではハイドロタルサイト化合物粒子はその表面をケイ素化合物、ホウ素 化合物、アルミニウム化合物からなる群から選ばれた少なくとも1種の化合物に より改質することもできる。

表面を被覆して改質することにより、塩基性を低くし、プラス荷電を低くする 15 ため、樹脂の着色、変色をおさえることができる。

これら表面改質剤としては、ケイ素化合物、ホウ素化合物またはアルミニウム 化合物が例示される。具体的には例えばメタケイ酸ナトリウム、オルトケイ酸ナトリウム、1、2、または3号水ガラス等のケイ酸ナトリウム、ケイ酸リチウム、メタケイ酸カリウム、オルトケイ酸カリウム、四ホウ酸ナトリウム、メタホウ酸 ナトリウム、オルトアルミン酸ナトリウム、オルトアルミン酸カリウム、オルトアルミン酸ナトリウム、オルトアルミン酸カリウム、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウム、リン酸アルミニウム等を挙げることができる。これらの表面改質剤はハイドロタルサイト化合物粒子100重量部に対し、Si、BまたはA1換算で2重量部以下の範囲で用いられる。このように表面改質されたハイドロタルサイト化合物粒子は前記の表面処理剤により、さらに付加的に処理されて、用いられることもできる。

例えばポリウレタン繊維は、その融点がウレタン結合の分解温度を越えており、 溶融紡糸による製糸が不可能なため、溶剤中で重合した後にポリウレタン溶液を 加熱気流中に押し出して乾燥する乾式紡糸、凝固浴中に押し出す湿式紡糸等の製造方法がとられる。また芳香族ポリアミド繊維(またはフィルム)の製造の場合も同様の理由によって主として湿式による成形法が援用される。本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は、有機極性溶媒に対して親和性、分散性に優れているので、この粒子がポリウレタンまたは芳香族ポリアミド中に均質に分散した成形物(繊維やフィルム)が得られる。かくしてポリウレタンまたは芳香族ポリアミド中においてハイドロタルサイト化合物粒子は耐塩素剤として優れた効果を発現することになる。

かくして本発明によれば(I)(A)ハイドロタルサイト化合物粒子、(B)有10 機極性溶媒および(C)ポリウレタンよりなる乾式もしくは湿式成形用原液(I)が提供され、また(II)(A)ハイドロタルサイト化合物粒子、(B)有機極性溶媒および(C)芳香族ポリアミドよりなる乾式もしくは湿式成形用原液(II)が提供される。

前記成形用原液(I)において、ハイドロタルサイト化合物の含有量は0.0 15 5~5重量%、好ましくは0.1~3重量%が適当であり、ポリウレタンの含有量は10~45重量%、好ましくは20~35重量%が適当である。

一方、前記成形用原液(II)において、ハイドロタルサイト化合物の含有量は 0.05~5重量%、好ましくは0.1~3重量%が適当であり、芳香族ポリア ミドの含有量は5~40重量%、好ましくは7~30重量%が適当である。

20 ポリウレタンおよび芳香族ポリアミド中には、通常添加される他の添加剤、例えば、酸化防止剤、光安定剤、紫外線吸収剤、耐ガス安定剤、着色剤、つや消し剤、充填剤等を配合することができる。これらの添加剤は、成形用の原液中に添加される。

本発明のハイドロタルサイト化合物粒子は、最終的にポリウレタンまたは芳香 25 族ポリアミド中に0.1~10重量%、好ましくは0.5~5重量%の範囲で添加 される。

本発明においてポリウレタンとは、通常弾性繊維の製造に使用されるものであ り、例えば、ジオールがウレタン結合によって連結されたソフトセグメント部分 と例えば有機ジイソシアネートとジアミンとのポリウレアであるハードセグメント部分からなるセグメント化ポリウレタンと称するものである。例えば、ポリエステルジオール、ポリエーテルジオール、ポリカーボネートジオール、ポリラクトンジオール、またはこれらの混合物、またはこれらの共重合物と有機ジイソシアネートとを反応させて得られた分子量1,000~3,000で両末端にイソシアネート基を有するプレポリマーと、鎖伸長剤である二官能性活性水素化合物例えばエチレンジアミン、プロピレンジアミン、テトラメチレンジアミン、ペンタメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ヘプタメチレンジアミン、オクタ

10 アミノセミカルバジド等のヒドラジン誘導体、エチレングリコール、1,3プロピレングリコール、1,4ーブタンジオール、ペンタメチレングリコール、ヘプタメチレングリコール等の低分子量グリコール類とを主成分とするポリウレタンである。

メチレンジアミン等のジアミン、ヒドラジンヒドラード、ビスセミカルバジド、

また芳香族ポリアミドとは、メタフェニレンジアミン、パラフェニレンジアミン、3,4'ージアミノジフェニルエーテルまたは4,4'ージアミノジフェニルエーテルの如き芳香族ジアミンと、イソフタル酸ジクロライドまたはテレフタル酸ジクロライドの如き芳香族ジカルボン酸クロライドとの反応によって得られたものであり、具体的には、ポリメタフェニレンイソフタラミドまたはその共重合体、ポリパラフェニレンテレフタラミドまたはその共重合体が挙げられる。

20

実施例

次に実施例により本発明を具体的に説明する。

以下の物性および特性は下記方法および手段により測定した。

- (1) <u>平均二次粒子径</u>:レーザ回折散乱法による粒度分布測定を行い、得られた 25 MV値を平均二次粒子径とした。
 - (2) <u>アスペクト比(長径/厚さ)</u>: 走査型電子顕微鏡 J S M 6 3 0 0 型で倍率 5 0 0 0 0 倍に設定し、直立粒子を探し、その厚さと径を実測する。 ここでアスペクト比は長径/厚さとする。

- (3) <u>BET比表面積</u>:液体窒素温度での窒素吸着量を測定しBET法により比表面積を求めた。
- (4) <u>DMAC溶液粘度</u>: DMAC (ジメチルアセトアミド) 溶剤にハイドロタルサイト化合物粒子試料を投入後、ホモミキサーで1時間攪拌して13重量%D5 MAC 緊濁液を作成し、25℃にてB型粘度計を用いて粘度測定を行った。
- (5) <u>最終沈降容積率</u>: 粘度測定後、各試料のDMAC縣濁液をメスシリンダーに移して約一ヶ月間静置して沈降容積を測定し、もとの縣濁液容積に対するパーセントで表した。位相差法光学顕微鏡による観察結果より、DMAC縣濁液の沈降容積の小さいものは分散性に優れており、逆に沈降容積が大きいものは分散性が悪いことが確認されているので、沈降容積にて分散性の程度を表現した。最終沈降容積率が小さいほど、分散性に優れていることを示す。
- (6) <u>pH-STATによる酸反応性の測定</u>:50ml容のビーカーに純水50mlを入れ恒温槽に置き、37.5℃とした。該ビーカー中にpHメーター電極および1N-HCl滴定液の注加シリンジをセットした後、攪拌下で試料500mgを投入し、設定pH2.0にて1N-HClの消費量を時間に対して記録した。試料の25モル%に相当する1N-HCl量(4.25ml)を消費するのに要した時間T25を測定した。T25値が小さいほど、酸との反応性が高く、また大きいほど反応性が低いことを示す。
 - (7) SO₄含量:比色法
- 20 (8) C1含量:吸光光度法
 - (9) SiO,含量:重量法

次に、本発明を実施例によりさらに詳しく説明する。

実施例1~10および比較例1~3

平均二次粒子径およびBET比表面積が異なる各種ハイドロタルサイト化合物 25 粒子試料について物性測定、化学分析および各テストを行い、それらの結果を表 1 に示した。

٣	4
1	X

:	<u>-</u>	数愈		胀	簡忽				-				
No.		比較例	比較例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例	実施例
	 1	83	က	,—I	0	က	4	5	6	7	8	6	10
平均粒子径(μm)	0.56	0, 55	0,65	0.79	0.89	0.9	0.9	1.07	0.72	1, 01	1	0.85	1.36
BET比表面積(m²/g)	11.2	14.8	12. 5	6	7	7.7	10	6.1	9.3	7.8	10	9.8	6
X	0.317	0.317	0.323	0.328	0.325	0, 325	0, 325	0.325	0.262	0.316	0.316	0.332	0.196
SO ₄ (ppm)	20	259	1140	250		75	88	80	290	150	70	500	300
CI(ppm)	13	10	40	32	30	59	15	30	40	90	50	40	70
SiO ₂ (%)											1	18. 1	14.6
アスペクト比(長径/厚さ)	8.5	6	8.1	3, 4	3.9	4.5	4.3	5	7	6.1	5.9	3	ນ
pHSTAT T25(分)	12.4	8	6	28.6	29.8	25.6	8.5	59	21	25. 1	23	27	, 20
DMAC溶液粘度(CPS)	1090	899	22	7	7	7.3	5.9	5	7.5	7.3	17	26	32
最終沈降容積率(%)	95	06	0.2	22	18	20	16	15	21	22	24	25	27
			24 44 4 74 4 4										

実施例4:実施例3のハイドロタルサイト化合物粒子を脱結晶水処理したもの実施例8:実施例7のハイドロタルサイト化合物粒子を3号ガラスで表面改質したもの実施例9:一般化学式 (I) において A^n -として $HSi_2O_5^2$ -を含むもの実施例10:同上

実施例11

300mlのビーカーに実施例2のハイドロタルサイト化合物粒子30.75 gを秤り取りDMAC236.5gを加えてホモミキサーにて5,500~6, 000rpmで1時間分散させてハイドロタルサイト化合物粒子分散液 [A] を 5 作成した。

30重量部のポリウレタンを含むDMAC溶液90重量部とフェノール系酸化 防止剤10重量部をホモミキサーにて5,500~6,000rpmで1時間混 合し、ポリウレタン [B] を作成した。このフェノール系酸化防止剤はチバガイ ギー社製IRGANOX 1010を使用した。

次にハイドロタルサイト化合物粒子分散液 [A] 60 重量部と、ポリウレタン 10 溶液 [B] 40重量部をホモミキサーにて5,500~6,000rpmで1時 間混合し、ポリウレタン溶液 [C] を調製した。

前記DMAC溶液90重量部に対してポリウレタン溶液[C]10重量部を添 加してホモミキサーにて5. 500~6, 000 rpmで1時間混合し、下記組 15 成のポリウレタン成形用原液とした。

ポリウレタン成形用原液の組成;

ハイドロタルサイト化合物粒子 0.78重量部

フェノール系酸化防止剤

0.4重量部

ポリウレタン 20

28.08重量部

DMAC

70.74重量部

実施例12

実施例7のハイドロタルサイト化合物粒子を用いる以外は実施例11と同様の 25 操作でポリウレタン成形用原液を作成した。

実施例13

実施例8のハイドロタルサイト化合物粒子を用いる以外は実施例11と同様の

操作でポリウレタン成形用原液を作成した。

実施例14

実施例10のハイドロタルサイト化合物粒子を用いる以外は実施例11と同様 5 の操作でポリウレタン成形用原液を作成した。

実施例11~14で得られた成形用原液は、いずれも着色・変色はなく、メッシュ・ろ過性においても問題なく、また5時間静置も成分の沈降・分離等の変化は認められず、良好な安定した状態を示した。

10

実施例15

m-フェニレンジアミン (MPD) 108gとイソフタル酸ジクロリド (IPC) 203gを360gのDMAC溶液中で、低温溶液重合を行った。続いて、25重量%の水酸化カルシウム (Ca (OH)₂) DMAC溶液を296g加え て中和したのち、実施例4のハイドロタルサイト化合物粒子 (脱結晶水品)のDMAC分散液80gを添加して混合し、ポリメタフェニレンイソフタルアミドの成形用原液を得た。

得られた成形用原液は下記に示す組成となっている。

ポリマー

22. 7重量部

20 ハイドロタルサイト化合物粒子

1. 1重量部

DMAC

62.1重量部

また、得られた成形用原液は着色・変色はなく、また5時間静置も成分の沈 降・分離等の変化は認められず、良好な安定した状態を示した。

25 発明の効果

本発明によれば、有機極性溶剤に容易に分散可能なハイドロタルサイト化合物 粒子が提供できる。同時に、各種ポリマー、色素等に安定剤として添加する際、 まず有機極性溶剤に縣濁したのち混合する方式を採らざるを得ない場合に特に好

PCT/JP01/06335 WO 02/08123

15

適で、とりわけ、湿式粉砕処理なしで容易に用いられ着色、変色、メッシユ詰ま り等の外観上および工程上の問題を起こさない、低環境負荷型の、ポリウレタン もしくは芳香族ポリアミド成形品用耐塩素剤を提供することができる。

5

WO 02/08123 PCT/JP01/06335

16

請求の範囲

- 1. (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が0.60~3 μ mであり、
- 5 (2) BET法により測した比表面積が0.5~10m²/gであり、かつ
 - (3) 結晶粒子形状が板状である

ハイドロタルサイト化合物粒子 および

(B) 有機極性溶媒

よりなる分散液。

10

- 2. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子の含有量が $10\sim30$ 重量%である請求項1記載の分散液。
- 3. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、1. 7~8の平均アスペクト比(長 15 径/厚さ)を有する請求項1記載の分散液。
 - 4. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、その表面が表面処理剤により表面処理されている請求項1記載の分散液。
- 20 5. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、有機極性溶媒中で湿式粉砕処理をしないで調製された請求項1記載の分散液。
 - 6. (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が0.60 ~ $3\mu\mathrm{m}$ であり、
- 25 (2) BET法により測定した比表面積が0.5~10m²/gであり、かつ
 - (3) 結晶粒子形状が板状である

ハイドロタルサイト化合物粒子

(B) 有機極性溶媒 および

- (C) ポリウレタン
- よりなる乾式もしくは湿式成形用原液。
- 7. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子の含有量が 0. 05~5重量%でありか つポリウレタンの含有量が 10~45重量%である請求項 6記載の成形用原液。
 - 8. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、1. 7~8の平均アスペクト比(長径/厚さ)を有する請求項6記載の成形用原液。
- 10 9. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、その表面が表面処理剤により表面処理されている請求項6記載の成形用原液。
 - 10. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、有機極性溶媒中で湿式粉砕処理をしないで調製された請求項6記載の成形用原液。

15

- 11. (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が 0.60 ~ 3 μmであり、
- (2) BET法により測定した比表面積が $0.5 \sim 10 \,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ であり、かつ
- (3) 結晶粒子形状が板状である
- 20 ハイドロタルサイト化合物粒子 を含有するポリウレタン繊維。
 - 12. 前記ハイドロタルサイト化合部の含有量が0. 1~10重量%である請求項11記載のポリウレタン繊維。

25

13. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、1. 7~8の平均アスペクト比(長径/厚さ)を有する請求項11記載のポリウレタン繊維。

- 14. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、その表面が表面処理剤により表面 処理されている請求項11記載のポリウレタン繊維。
- 15. 請求項6記載の成形用原液を乾式もしくは湿式成形して得られた請求項1 1記載のポリウレタン繊維。
 - 16. (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が0.60 ~ $3\mu m$ であり、
 - (2) BET法により測定した比表面積が $0.5\sim10\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ であり、かつ
- 10 (3) 結晶粒子形状が板状である

ハイドロタルサイト化合物粒子

- (B) 有機極性溶媒 および
- (C) 芳香族ポリアミド

よりなる乾式もしくは湿式成形用原液。

15

- 17. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子の含有量が $0.05\sim5$ 重量%でありかつ芳香族ポリアミドの含有量が $5\sim40$ 重量%である請求項16記載の成形用原液。
- 20 18. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、1.7~8の平均アスペクト比(長径/厚さ)を有する請求項16記載の成形用原液。
 - 19. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、その表面が表面処理剤により表面処理されている請求項16記載の成形用原液。

25

- 20. (A) (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が0.60 ~ 3μ mであり、
- (2) BET法により測定した比表面積が $0.5\sim10\,\mathrm{m}^2/\mathrm{g}$ であり、かつ

PCT/JP01/06335

- (3)結晶粒子形状が板状である ハイドロタルサイト化合物粒子 を含有する芳香族ポリアミドフィルムまたは繊維。
- 5 21. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子の含有量が0.1~10重量%である 請求項20記載の芳香族ポリアミドフィルムまたは繊維。
 - 22. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、1.7~8の平均アスペクト比 (長径/厚さ)を有する請求項20記載の芳香族ポリアミドフィルムまたは繊維。

10

- 23. 前記ハイドロタルサイト化合物粒子は、その表面が表面処理剤により表面処理されている請求項20記載の芳香族ポリアミドフィルムまたは繊維。
- 24. 請求項16記載の成形用原液を乾式もしくは湿式成形して得られた請求項15 20記載の芳香族ポリアミドフィルムまたは繊維。
 - 25. (1) レーザ光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が $0.60\sim3$ μ mであり、
 - (2) BET法により測定した比表面積が0.5~10m²/gであり、かつ
- 20 (3) 結晶粒子形状が板状である、

ことを特徴とする有機極性溶媒分散用ハイドロタルサイト化合物粒子。

26. 平均アスペクト比(長径/厚さ)が1.7~8の範囲の板状の結晶粒子形状を有する請求項25のハイドロタルサイト化合物粒子。

25

27. 表面処理剤により表面処理された請求項25記載のハイドロタルサイト化合物粒子。

- 28. ケイ素化合物、ホウ素化合物およびアルミニウム化合物、よりなる群から選ばれた少なくとも1種により表面改質された請求項25記載のハイドロタルサイト化合物粒子。
- 5 29. 表面処理剤が、高級脂肪酸類、アニオン系界面活性剤、リン酸エステル類 およびカップリング剤よりなる群から選ばれた少なくとも1種である請求項3ま たは25記載のハイドロタルサイト化合物粒子。
- 30. レーザー光回折散乱法により測定した平均二次粒子径が $0.8 \sim 2 \mu \text{ m}$ で 10 ある請求項25記載のハイドロタルサイト化合物粒子。
 - 31. レーザー光回折散乱法により測定した二次粒子径が5μm以上である粒子が1%以下である請求項25記載のハイドロタルサイト化合物粒子。
- 15 32. 平均アスペクト比(長径/厚さ)が2~6の範囲の板状の結晶粒子形状を 有する請求項25記載のハイドロタルサイト化合物粒子

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/06335

A. CLASS Int.	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl ⁷ C01F7/00, C08J5/00, C08L75 D01F6/90	5/04, C08K3/26, C08L77/0	0, D01F6/94,	
According to	According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC			
B. FIELDS	B. FIELDS SEARCHED			
Minimum do Int .	ocumentation searched (classification system followed b Cl ⁷ C01F7/00, C08J5/00, C08L75 D01F6/90		0, D01F6/94,	
Jits Koka	ion searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K	oho 1994-2001 oho 1996-2001	
	ata base consulted during the international search (name ONLINE, WPI/L	e of data base and, where practicable, sea	rch terms used)	
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category*	Citation of document, with indication, where app	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
X A	JP 2000-119510 A (Kabushiki Kai Kenkyusho), 25 April, 2000 (25.04.00), Claim 4; Par. Nos. [0021], [002	J	6-15 1-5,16-32	
X A	JP 2000-198979 A (Kyowa Chem. I 18 July, 2000 (18.07.00), Claims 1, 3, 6; Par. Nos. [0013 examples 1, 5, 6 & EP 1046672 Al & WO 00/262] to [0016]; working	6-15 1-5,16-32	
х	X EP 989095 A1 (Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.), 29 March, 2000 (29.03.00), Par. No. [0023]; working examples 4, 7 & JP 2000-159520 A Par. No. [0031]; working examples 4, 7 & AU 9948835 A & NO 9904588 A & CN 1248590 A & KR 2000020705 A & US 6287532 B1			
☐ Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	l	
"A" docum consid "E" earlier date "L" docum cited t specia "O" docum means "P" docum than the	"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means			
10	actual completion of the international search October, 2001 (10.10.01)	Date of mailing of the international sea 23 October, 2001 (2		
Name and a	mailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer		
Facsimile 1	No.	Telephone No.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/06335

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
X	EP 952189 Al (Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.), 27 October, 1999 (27.10.99), Claims; Par. No. [0049]; page 13, table 1 & US 6291570 A & WO 99/05219 Al Claims; page 10, lines 6 to 20; page 22, table 1	20-24
х	EP 301509 Al (Kyowa Chemical Industry Co., Ltd.), 01 February, 1989 (01.02.89), Full text & JP 1-36654 A Full text & DE 3853599 G & KR 9513148 Bl & CA 1341233 C	20-24
	-	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調查報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' C01F7/00, C08J5/00, C08L75/04, C08K3/26, C08L77/00, D01F6/94, D01F6/90

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.Cl' C01F7/00, C08J5/00, C08L75/04, C08K3/26, C08L77/00, D01F6/94, D01F6/90

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

日本国公開実用新案公報

1926-1996年 1971-2001年

1994~2001年

日本国登録実用新案公報 日本国実用新案登録公報

1996~2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CAS ONLINE, WPI/L

C. 関連する	6と認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
Х	JP 2000-119510 A(株式会社海水化学研究所)25.4月.2000	6-15
A	(25.04.00)請求項4,【0021】,【0025】(ファミリーなし)	1-5, 16-32
X	JP 2000-198979 A(協和化学工業株式会社)18.7月.2000	6-15
A	(18.07.00) 請求項1,請求項3,請求項6,【0013】-【0016】	1-5, 16-32
	実施例1,実施例5,実施例6 & EP 1046672 A1 & WO 00/26289 A1	· ·
	,	
	'	

区欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 10.10.01	国際調査報告の発送日 23.10.01
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4 G 9439
明伊番号100-8915 東京都千代田区設が関三丁目4番3号	安齋美佐子 電話番号 03-3581-1101 内線 3416

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Х	EP 989095 A1(KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD)29.3月.2000 (29.03.00) 【0023】実施例4,実施例7 & JP 2000-159520 A 【0031】,実施例4,実施例7 & AU 9948835 A & NO 9904588 A & CN 1248590 A & KR 2000020705 A & US 6287532 B1	1, 25
X	EP 952189 A1 (KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD) 27. 10月. 1999 (27. 10. 99) 特許請求の範囲,【0049】,第13頁表 1 & US 6291570 A & WO 99/05219 A1 特許請求の範囲,第10頁第6行-第20行,第22頁表1	20-24
X	EP 301509 A1(KYOWA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD)1.2月.1989 (01.02.89)全文 & JP 1-36654 A 全文 & DE 3853599 G & KR 9513148 B1 & CA 1341233 C	20-24
		·
	_	